## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-298790

(43)Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.Cl.

H01J 65/00 H01L 21/302 H01L 21/304

(21)Application number: 2001-096289

/74\A !! .

(71)Applicant: SHINETSU ENGINEERING KK

(22)Date of filing:

29.03.2001

(72)Inventor: ONODA TADAYOSHI

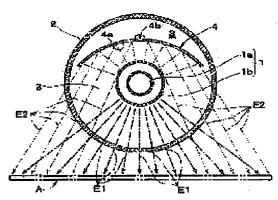
**SAKAI IKUO** 

## (54) EXCIMER LIGHTING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase an irradiating amount to an irradiated body while preventing reduction of an excimer light with a simple structure.

SOLUTION: A nitride gas 3 is introduced and a reflecting body 4 is provided in a space S between an excimer UV lamp 1 and a protecting tube 2. Thus, an excimer light E1 emitted from an opposite surface side of the excimer UV lamp 1 is directly irradiated to the irradiated body A through the protecting tube 2 without being absorbed. An excimer light E2 emitted to a back surface side other than that is reflected by the reflecting body 4 and is irradiated to the irradiated body A through the protecting tube 2.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

{Date of extinction of right]

(19)日本国格群庁 (JP)

€ 辍 4 盂 华 噩 4 22

**特開2002-298790** 

(11)特許出版公開番号

(P2002-298790A)

平成14年10月11日(2002, 10, 11)

(43)公開日

アマコート"(参加)	A 5F004	6 4 5 D	2
F I	H01J 65/00	H01L 21/304	21/302
裁別記号			645

21/304 H01L 21/302 H011 65/00 (51) Int.Ct.

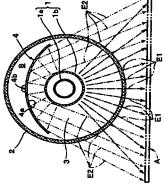
(全 5 買) 審査額求 未踏水 請求項の数3 01

				,
(21)出版路舟	特 <b>第</b> 2001-96289(P2001-96289)	(71) 田間人	(71) 出國人 000190105	!
(22) 出版日	平成13年3月29日(2001.3.29)		信様エンジニアリング株式会社 東京都子代田区袖田公司・7日の条地	
		(72) 発明者	大野田 忠与	
			東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 信	ta
			組エンジニアリング株式会社内	
		(72) 発明者	坂井 都夫	
			東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 曾	fu
			はエンジニアリング株式会社内	
		(74)代理人	(74)代理人 100090619	
			弁理士 長南 講輝男 (外2名)	
•			発体更に扱く	¥

(54) [発明の名称] エキシマ照明拡配

【課題】 簡単な構造でエキシマ光の減衰を防止しなが ら披照射体への照射量を増大させる。

して被照射体Aに直接照射されると共に、それ以外の背 【解決手段】 エキシマUVランプ1と保護管2との笠 **聞Sに、窒素ガス2を流すと共に反射体4を配設するこ** とにより、エキシマUVラング1の対向面倒から発光し たエキシマ光日1は、吸収されることなく保護管2を透 面側へ発光したエキシマ光丘2は、反射体4で反射さ



、特許請求の範囲】

(1)の外周に、エキシマ光の透過性に優れた材料で簡 空間(S)に、窒素ガス(3)を流すと共に、エキシマ **成照射体(A)側へ反射させる反射体(4)が設けられ** エキシマUVランブ(1)から発光されたエキシマ光を **犬に形成された保護管(2)を設け、これらエキシマリ** Vランブ(1)と保護管(2)との間に区画形成される 【鯡求項1】 エキシマUVランブ (1) の周囲に存在 たエキシア照明装置において、前記エキシァUVランク する空気を置換するために窒素ガス (3) が供給され、

【静水項2】 前配保護管(2)を円筒状に形成した請 2)が被照射体(A)へ反射されるように反射体(4) を配散したことを特徴とするエキシア照明装置。 枚項 1 記載のエキシマ照明装置。

NVランブ (1) の背面側へ発光したエキシマ光 (E

(E2) のほとんどがエキシマUVランプ (1) の外側 キシマUVランブ(1)の外周面に沿って凹状に弯曲さ せ、この反射面(48)の曲率を、これと対向するエキ シマUVランブ(1 )の臀面倒から発光するエキシマ光 【請求項3】 前記反射体(4)の反射面(4a)をエ **ヽ拡関するようにした請求項1または2記載のエキシマ** 

(発明の詳細な説明)

0001

に窒素ガスが供給され、エキシマUVランブから発光さ [発明の属する技術分野] 本発明は、例えば液晶ディス エハに付着した有機汚染を酸化除去するドライ洗浄など キシマUVランブの周囲に存在する空気を置換するため ブレイの基板、マスク用石英ガラスやシリコン半導体ウ **に用いられるエキシマ照明装置に関する。詳しくは、エ** れたエキシマ光を披照射体側へ反射させる反射体が設け られたエキシマ照明装置に関する。

[0002]

り、酸エキシマUVランブから発光するエキシマ光(真 て、例えば特開平1-288109号公報や特開平8-|24540母公報に関示される如く、エキシマUVラ ンプ(誘導体バリア故電ランプ)が、合成石英製の平面 (財政を有する容器 (医体) の中に取り付けられ、この 数素雰囲気中の被照射体に照射され、その結果、汚れで 及び活性酸素を作り、その強力な酸化力で有機物を酸化 させ、二酸化炭素、二酸化窒素にして蒸発させるものが ある。しかも、上記容器内には、エキシマUVランプを **囲むように反射体が配置され、この反射体で反射したエ** キシマ光が平面原射窓を造して被照射体に照射され、こ ある有機物の結合を断ち切り、酸薬に吸収されてオゾン 空紫外光)が吸収されることなく平面照射窓を透して、 の反射板と窒素置換が組み合わせられることによって、 [従来の技術] 従来、この種のエキシヲ照明装置とし 容器内に窒素ガスを流して空気と置換させることによ

特別2002-298790

3

ランプに被照射体を接近できず、エキシッ光の照射効率 **【発明が解決しようとする課題】しかし乍ら、このよう** な従来のエキシマ肌明装置では、容器内に流される窒素 ガスの内圧に対して容器及び合成石英製の平面照射窓が 十分な強度を有する必要があるため、壁の厚い容器や厚 い平面照射窓を用いなければならず、その分だけ製造コ ストが商価でなって経済的でないと共に、エキシャリン が低下して洗浄効率が低下するという問題がある。しか も、複数のエキシマUVランプを並列状に配置する必要 がある場合には、容器の厚い壁を挟んでエキシマUVラ ンブが配置されるため、これらエキシマUVランブの電 **函を相互に接近させて配置できず、各電極の間隔が大き** く聞くから、被照射体への照射効率の低下すると共に被 【0004】本発明のうち請求項1記載の発明は、簡単 な構造でエキシマ光の複数を防止しながら被照射体への 照射量を増大させることを目的としたものである。請求 項2記載の発明は、請求項1に記載の発明の目的に加え て、エキシマUVランプと被照射体や複数のエキシマU Vランブの相互を更に接近させることを目的としたもの である。請求項3記載の発明は、請求項1または2に記 **説の発明の目的に加えて、被照射体への照射強度と照射** 照射体上の照度分布がバラ付き易いという問題がある。 10 2

ランブと保護管との間に区画形成される空間に、窒柔ガ 【課題を解決するための手段】前述した目的を違成する とめに、本発明のうち請求項1記載の発明は、エキシマ UVランブの外周に、エキシマ光の透過性に優れた材料 で簡状に形成された保護管を設け、これろエキシマリソ [0005] 8

**面積を向上させることを目的としたものである。** 

スを流すと共に、エキシマUVランブの背面側へ発光し

たエキシマ光が被照射体へ反射されるように反射体を配 **設したことを特徴とするものである。 精水項2記載の発** 明は、請求項1記載の発明の構成に、前記保護管を円筒 **伏に形成した構成を加えたことを特徴とする。 請求項3** って四状に済曲させ、この反射面の曲等を、これと対向 するエキシマUVランプの背面側から発光するエキシマ **判記反射体の反射面をエキシマUVランプの外周面に沿** 光のほとんどがエキシマUVランブの外側へ拡関するよ 記載の発明は、請求項1または2記載の発明の構成に、 **うにした構成を加えたことを特徴とする。** 6

【作用】鯖水項1の発明は、エキシマUVランプと保護 **替との空間に、窒柔ガスを流すと共に反射体を配設する** Cとにより、エキシマUVランブの対向面側から発光し たエキシマ光は、吸収されることなく保護管を造して法 照射体に直接照射されると共に、それ以外の背面側へ発 光したエキシマ光は、反射体で反射され、保護管を透し (0000)

は、朝求項1記載の構成に対して、前記保護管を円筒状 て被照射体に照射されるものである。 請求項2の発明

照射強度と照射面積を向上させている。

AVAILABLE COPY BEST

h、保護管2を透して被照射体Aに照射される。

**に形成した構成を追加したので、円筒状の保護管は、構** 造上徴度に優れるから、その厚さを薄くしても窒素ガス 圧に十分耐えられる。 請求項3の発明は、 請求項1また マUVランブの外周面に沿って凹状に弯曲させ、この反 マ光のほとんどが、反射体の反射面に反射されて、エキ は2記載の構成に対して、前記反射体の反射面をエキシ **射面の曲率を、これと対向するエキシマUVランプの背** 面側から発光するエキシマ光のほとんどがエキシマUV で、エキシマUVランブの背面側から発光されるエキシ シマUVランブへ戻らずに被照射体に直接照射される。 ランブの外側へ拡関するようにした構成を追加したの

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面に基 Jur説明する。この実施例は、図1及び図2に示す如 た内部電極1aと、その外側に配置された網状円筒形の く、エキシァUVランブ1が、網状の円筒形に形成され 2nmのエキシマ光を放射状に照射する二重円筒型構造 外部電極 1 b とを同軸状に配置することによって、1 7 であり、このエキシマUVランブ 1 から所定間隔をあけ て被照射体Aが配置される場合を示すものである。

【0008】上記エキシマUVランブ1は、図示例の場 合、図2 に示す如く、その軸方向一端又は両端に内部電 極1a及び外部電極1bを支持するためのホルダー1 c が装着され、このホルダー1cには、内部電極1m及び 外部電極 1 bに高周波電圧を印加させるための接続コー ド(図示せず)が梅通されている。

部電価1 b を保護するための保護管2 が設けられ、これ [0009] このエキシマUVランブ1の外周には、外 らエキシマUVランプ 1 と保護管 2 との間には、空間S

【0010】この保護管2は、エキシマ光の透過性に優 れ、上記エキシマUVランブ1の内部電極1 a 及び外部 れた例えば合成石英ガラスなどの材料で簡状に形成さ 電極1bと問軸状に配置する。

[0011] 本実植例の場合には、保護管2の両端又は −協のみが開口する円筒状に形成し、その関□編2 a を 上記エキシマUVランブ 1 のホルダー 1 c に密着固定す ることにより、密閉した空間Sが形成される。

[0012]そして、これらエキシマUVランブ1と保 賃管2との空間5には、窒素ガス3を流すと共に、エキ 背面側へ発光されたエキシマ光E2が被照射体Aへ反射 シァUVランブ1の被照射体Aとの対向面側とは反対の されるように反射体4を配設する。

6

マ光の吸収をなくして光エネルギーの減衰が防止される [0013]との窒素ガス3は、上記空間S内に存在す る空気を排除するために供給されることにより、エキシ と共に、内部電極1 a 及び外部電極1 bの酸化を防止し

ンブ1のホルダー1 cの中央部に、窒素ガス3の流入口 【0014】本実施例の場合には、上記エキシマUVラ

3 a を開穿し、この流入口3 a から内部隔極1 a 内に窒 **発ガス3を流して酸内部電極1gの先端部まで導くと共** てとにより、これら内部電極1g及び外部電極1bが冷 却され、更に外部電極1bの網状部分を通って保護管2 **に、その網状部分を通って外部電極1bとの空間へ流す** との空間Sへ流れ出た窒素ガス3が、ホルダー1cの外 周部に開穿した流出口35から外部へ排出している.

【0015】上記反射板4は、エキシマ光の反射率に優 **れた材料、例えば金属などの材料で形成され、本実植例** どがエキシマUVランプ1の外側へ拡開するように保護 では、エキシマUVランブ1の背面側と対向する反射面 せ、この反射面4aの曲率を、これと対向するエキシマ UVランプ!の背面側から発光するエキシマ光のほとん 48を、外部電極1bの外周面に沿って四状に湾曲さ 音2の曲率と略同じかそれより小さくしている。

[0016] 図示例では、この反射板4がアルミニウム ガー4bを介して吊り下げることにより、移動不能に配 上記エキシマUVランブ1のホルダー1cに対し、ハン 板であり、その少なくとも反射面4aを鏡面仕上げし、 置固定している。

は、図1及び図2に示したように、被照射体Aに対して 数のエキシマUVランブ1…を並列状に配置する場合も エキシマUVランブ1を1つのみ配備するだけでなく、 【0017】また、上述した構造のエキシマ照明装置 図3に示すように、被照射体Aの大きさに対応して、

【0018】次に、斬かるエキシマ照明装置の作用につ いて説明する。先ず、図2に示す如く、エキシマUVラ ンブ1と保護管2との空間Sに窒素ガス2を流した状態 で、エキシマUVランプ1の内部電伍1a及び外部電伍 1 b に商周波電圧が印加されると、図1に示す如く、エ キシマUVランブ 1 の外周面からエキシマ光が放射方向

【0019】被照射体Aと対向するエキシマUVランブ |の対向面側から発光したエキシマ光E1は、上記空間 **巻して被照射体Aに直接照射される。それ以外のエキシ** 3の窒素ガス2により、吸収されることなく保護管2を **反射体4により被照射体Aへ向けて反射され、保護管2** マリソランブ1の背面側へ発光したエキシャ光E2は を透して被照射体Aに照射される。 【0020】その結果、簡単な構造でエキシマ光の減衰 を防止しながら被照射体Aへの照射量を増大できる。従 って、例えば特開平1-288109号公報や特開平8 - 124540号公報に開示されるような壁の厚い容器 や厚い平面照射窓が不要となり、その部だけ製造コスト を低減できて経済的であると共に、エキシマUVランブ | に対して被照射体Aを接近でき、エキシマ光の照射効 **幹が高くなって、洗浄効率を向上できる。** 

【0021】しかも、例えば被照射体Aの大きさに対応 して、複数のエキシマUVランブ 1 …を並列状に配置す

ន

流す空間Sが各エキシマUVランブ! 毎に隔離されて夫 1-288109号公報や待開平8-124540号公 接近させて配置でき、高い照射効率の下で被照射体A上 る必要がある場合には、図3に示す如く、例えば特関平 **れろエキシマUVランブ1…の電極1a,1bを相互に** 124540号公報に開示された複数のエキシマ∪∨ラ 報に開示されるような容器の厚い壁が不要となって、と ンプ1…を並列状に配置したものに比べ、窒素ガス3を 4の堆積が小さいので、窒素ガス3への置換を短時間で は、例えば特閒平1-288109号公報や待開平8-の照度分布をより均一にできる。特に図3に示すもの 行えるという利点がある。

[0022] 更化、本実施例の場合には、上記保護管2 を円筒状に形成したので、構造上強度に優れ、その厚さ エキシマUVランプ 1 と被照射体Aや複数のエキシマU を薄くしても窒素ガス圧に十分耐えられる。その結果、 Vランブ1…の相互を更に接近できる。

円弧状に済曲させ、この反射面4gの曲率を、これと対 [0023] 更にまた、本実施例の場合には、反射体4 向するエキシマUVランプ1の背面側から発光するエキ の反射面48をエキシマUVランブ1の外周面に沿って シマ光E2のほとんどがエキシマUVランプ (1)の外 剛へ拡闊するようにしたので、エキシャUVランブ

**例と同じものである。図示例の場合には、四角形の筒状** (1) へ戻らずに被照射体Aに直接照射される。その結 **尨例である。このものは、前記保護管2を多角形の筒状** は異なり、それ以外の構成は図1及び図2に示した実施 に形成しているが、五角形以上の多角形に形成しても良 [0024]一方、図4に示すものは、本発明の他の実 に形成した構成が、前記図1及び図2に示した実施例と 果、被照射体Aへの照射強度と照射面積を向上できる。

[0025]従って、図4化示すものも、図1及び図2 に示した実施例と同様に、被照射体Aと対向するエキシ は、上記空間Sの窒素ガス2により、吸収されることな て反射され、四角形の保護管2を透して被照射体Aに照 た、それ以外のエキシマロVランブ1のמ面倒へ発光し たエキシマ光E2は、反射体4により被照射体Aへ向け **マリソランブ1の対向面側から発光したエキシャ光圧** く四角形の保護管2を透して被照射体Aに直接照射さ

体Aまでの距離を均一にでき、エキシァリVランブ1の 部と対向する部分A1と、それから離れた保護管2の底 面端部と対向する部分A2とを比較しても、前記図1及 18. 1 bから離れるものの、反射体4で反射されたエ キシマ光が照射されるため、全体的に照射量を略同じに 【0028】その結果、保護管2の底面全体から被照射 電極18.1bから最短距離にある保護管2の底面中央 び図2に示した実施例に比へ、エキン光の減衰量に大き な差がなく、特に底面矯卸と対向する部分A2は、電極

2

項1記載の発明は、エキシマUVランプと保護管との空 体に照射されるので、簡単な構造でエキシマ光の減衰を 【発明の効果】以上説明したように、本発明のうち請求 間に、窒衆ガスを流すと共に反射体を配数することによ り、エキシマUVランブの対向面関から発光したエキン マ光は、吸収されることなく保護管を透して被照射体に キシマ光は、反射体で反射され、保護管を透して被照射 直接照射されると共に、それ以外の背面側へ発光したェ 坊止しながら被照射体への照射量を増大できる。従っ

て、窒素ガスの内圧に対して壁の厚い容器や厚い平面照 射窓が必要な従来のものに比べ、これら壁の厚い容器や 厚い平面照射窓が不要となって、製造コストを低減でき て程済的であると共に、エキシマUVランプに対して法 Vランプを並列状に配置する必要がある場合には、容器 の厚い壁を挟んでエキシマUVランブが配置される従来 のものに比べ、容器の厚い壁が不要となって、これらエ **暫い照射効率の下で被照射体上の照度分布をより均一に** て、洗浄効率を向上できる。しかも、複数のエキシャリ 照射体を接近でき、エキシマ光の照射効率が描くなっ キシマUVランブの電極を相互に接近させて配置でき

【0030】請求項2の発明は、請求項1の発明の効果 5、その厚さを薄くしても窒紫ガス圧に十分耐えられる ので、エキシマUVランプと被照射体や複数のエキシマ **だ加えて、円筒状の保護管は、構造上強度に優れるか** UV ランプの相互を更に接近できる。

【0031】請求項3の発明は、請求項1または2の発 明の効果に加えて、エキシマUVランブの背面倒から発 光されるエキシマ光のほとんどが、反射体の反射面に反 Hされて、エキシァUVゥンブへ戻らずに被照射体に直 **養照射されるので、被照射体への照射強度と照射面積を** 4

図画の簡単な説明

【図1】 本発明の一実施例を示すエキシマ照明装置の 貨断面図である。

【図2】 同斜視図である。

複数のエキシマリソランブが批列状に配置さ [图3]

S

€

特開2002-298790

キシマ照明装置を、図3に示すように、被照射体Aの大 きさん対応して、複数のエキシマUVランプ1…を並列

【0021】また、図示せぬが、図4に示した構造のエ

できるという利点がある。

とも反射面48を鏡面仕上げした反射板4を、エキシマ UVランブ1のホルダー1 cに対し、ハンガー4bを介

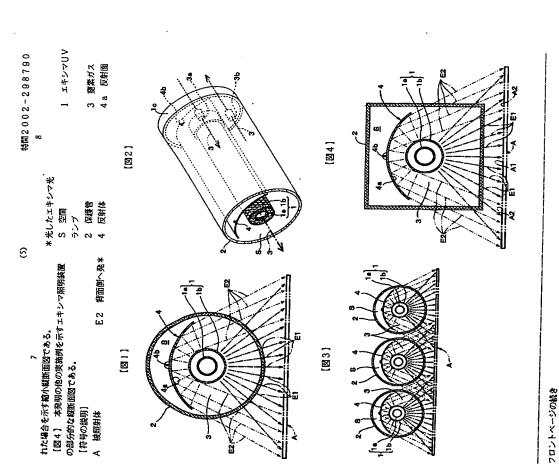
[0028]尚、図示例では、アルミニウム板で少なく

状に配置しても良い。

が、これに限定されず、図示せぬが、反射板4をアルミ ニウム以外の材料で形成したり、保護管2の内面に貼着

して移動不能に配置固定しても良い。

して吊り下げることにより、移動不能に配置固定した



Fターム(参考) 5F004 AA16 BA20 BB05 BC08